

# DIN 50453-2:2023-08 (D)

## Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen - Teil 2: Siliciumdioxid-Schichten, Optisches Verfahren

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Kurzbeschreibung des Verfahrens</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Geräte</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Silicium-Substrat</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Zusammensetzung der Ätzmischungen</b> .....	<b>5</b>
<b>8 Einflüsse auf das Messergebnis</b> .....	<b>5</b>
<b>8.1 Struktur der Siliciumdioxid-Schicht</b> .....	<b>5</b>
<b>8.2 Temperatur</b> .....	<b>5</b>
<b>8.3 Dotierung</b> .....	<b>5</b>
<b>9 Probenvorbereitung</b> .....	<b>5</b>
<b>10 Durchführung</b> .....	<b>5</b>
<b>11 Auswertung</b> .....	<b>7</b>
<b>12 Präzision des Verfahrens</b> .....	<b>7</b>
<b>13 Prüfbericht</b> .....	<b>8</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>9</b>
 <b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Prüfaufbau zur Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen</b> .....	<b>6</b>